

高真空蒸着装置 RD-1600



高真空蒸着装置RD-1600は有機物専用蒸着装置で、有機セルを4ヶ搭載しております。

また、2ヶ同時成膜も可能です。

L/L室が付属されておりますので、成膜室を高真空状態に保持したまま基板の交換が可能です。

基板加熱はハロゲンランプを採用し300℃まで昇温可能です。

排気系は自動動作。成膜制御も有機セルと水晶振動式膜厚計の連動により膜厚レートの制御を自動的に行います。

高真空蒸着装置 RD-1600 仕様

- 到達圧力 ×10⁻⁵Pa台※常温・無負荷・脱ガス完了時
- 排気速度 大気圧から60分で1.2×10⁻⁴Pa台※常温・無負荷・脱ガス完了時
- 真空室径 内寸：φ580mm×625mmH SUS304 電解研磨処理 前扉方式
- 蒸着機構 有機セル：K熱電対による温度制御
有機セル数：4対(最大2源同時可能)
- 基板形状 □200mm以内
- 基板回転 回転数：0～20rpm
- 基板加熱 最高温度：300℃(基板表面上)
- 膜厚計 水晶振動式膜厚計
- 真空排気系 油回転ポンプ：403L/min[60Hz]
ターボ分子ポンプ：480L/sec
- 真空計 広帯域真空計
- 操作方法 排気系全自動(手動操作も可能)/成膜系全自動(手動操作も可能)
- 制御系 独立制御盤型：タッチパネル/シーケンサー/サイリスタユニット/各種コントローラ
- ユーティリティ 電気：AC200V三相5.0kVA
計装エア：圧力0.5MPa以上
乾燥窒素：圧力0.05MPa以上0.1MPa以下
- 装置寸法 装置本体：2472mmW×1200mmD×(1929)mmH
制御盤：570mmW×1000mmD×(1913)mmH